

GVC-1000 全自动离子溅射仪

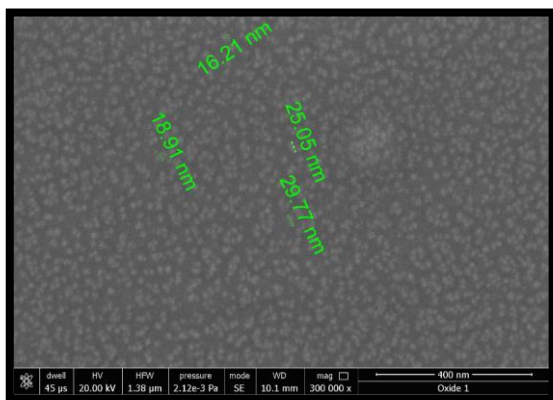


- 全自动控制，无需调整针阀
- 专利结构，靶材更换非常简单
- 特殊密封结构，玻璃不易损坏
- 专利结构，样品台高度调整方便
- 内置操作向导，无需培训即可熟练操作

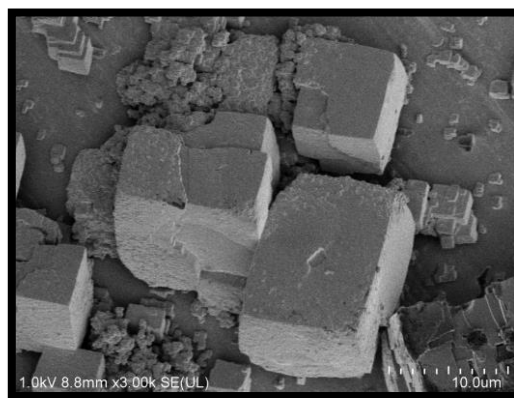
主要参数

外形尺寸	424 (L) × 271 (D) × 255 (H)	输入电源	220V/500W
可用靶材	金、铂、金钯合金等	靶材尺寸	φ57×0.12mm
真空室	高硅硼玻璃 φ125×125mm	工作介质	空气或氩气
真空泵	旋片泵 (可选配干泵)	抽速	≥1L/s
极限真空	≤1Pa	工作电流	2-30mA 连续可调
显示屏	5 英寸 800×480 彩色触摸屏	工作时间	1-999s 连续可调
进气	自动	放气	自动

示例图片



金颗粒尺寸 (硅片喷金)



某客户样品